(19)日本国特許庁(JP)

# (12)特許公報(B2)

(11)特許出顧公告番号

# 特公平8-2511

(24) (44)公告日 平成8年(1996) 1月17日

(51) Int.CL <sup>6</sup>	<b>微別記号</b> 方	内整理番号	ΡI	技術表示箇所
B23K 28/06	C			
	Α			{
	G		•	

前求項の数2(全 8 頁)

			所办为(VXX)(主 0 以/
(21)出顧番号	特顧平1~114708	(71)出顧人 999999999	
		松下電器産業	株式会社
(22)出顧日	平成1年(1989)5月8日	大阪府門真門	大字門真1006番地
		(72)発明者 船見 洛司	}
(65)公園番号	特周平2-295692	大阪府門京門	大字門頁1006番地 松下電器
(43)公庸日	平成2年(1990)12月6日	産業株式会社	1
Anna Antina In		(72)発明者 棺衫 雄二	
		g	大字門真1006番地 松下重器
		産業株式会社	11
		(72)発明者 西川 幸勇	-r
		,	5大字門頁1006譽地 松下電器
		<b>建築株式会</b> 社	
		(74)代理人 井理士 港本	
		(14/10至人) 分至工 /84	* 8.2
•		密查官 鈴木 由紀夫	<u>.</u>
		MTT D ANY MACY	
			最終質に続く

#### (54) 【発明の名称】 レーザ加工装置

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】レーザ発振器と、このレーザ発振器から出 たレーザ・ビームの断面強度を均一にすべく、中央部で はレーザ・ビームを拡げ、かつ周辺部ではレーザ・ビー ムを拡げない形状とした非球面を有する第1の非球面レ ンズと、前記第1の非球面レンズにより断面強度を均一 化されたレーザ・ビームを平行ビームに戻す形状とした 非球面を有する第2の非球面レンズと、前記第2の非球 面レンズを通過したレーザ・ビームの光路内に平面上に 1列もしくは複数列に集光レンズを配置して構成した集 10 装置の一例について説明する。 光光学装置とを備えたレーザ加工装置。

【請求項2】レーザ発振器と、このレーザ発振器から出 たレーザ・ビームの光路内に平面上に1列もしくは複数 列に配置された複数の集光レンズからなり、かつ前記複 数の集光レンズにおいて、各々の集光レンズに入射する

レーザ・ビームのエネルギ量を等しくすべく、中央部に 位置するものより周辺部に位置するものがレンズ径が大 きくなるよう構成したことを特徴とするレーザ加工装 置,

【発明の詳細な説明】

産業上の利用分野

本発明はレーザ加工装置に関するものである。 従来の技術

以下図面を参照しながら、上述した従来のレーザ加工

第10図は従来のレーザ加工装置のうち、X-Yテーブ ル型の構成図である。第10図において、1はレーザ発振 器。2はレーザ・ビーム。7は皮射ミラー、115は集光 レンズ、9は被加工物、10はX # Yテーブルである。レ ーザ発振器1から出たレーザ・ピーム2は、反射ミラー

7により90 偏向され、梟光レンズ115により被加工物 9上に照射される。 さらに、被加工物9は、X-Yテー ブル10にて移動され、所定の加工が施される。

一方、第11図は、従来のレーザ加工装置のうちガルバ ノ・メータ型ビーム走査装置の構成図である。第11図に おいて、15はカルバレ・メータ、16はガルバノ・ミラ ー、17は f θ レンズである。レーザ発振器 l から出たレ ーザ・ビーム2はカルバノ・メータ15によって助かされ る2枚のガルバノ・トラー16により平面上を走査されな がら、『ロレンズ17により被加工物9上に照射され、所 10 定の加工が施される。

しかしながら、上記のような加工跡を1本のレーズ・ ビーム2で形成する方法では、同一形状の加工を繰り返 し被加工物のに施す場合には、加工に時間がかかり十分 な生産能力が得られない。そのため、第12図に示す様な 多点同時加工できるレーザ加工装置がよく用いられてい

第12図において3b44bはレーザ・ビーム2aのビーム径 を拡大させるための曲レンズ、5と6はレーザ・ビーム 集光光学装置。11は平凸レンズである。

以上のように構成されたレーザ加工装置において、そ の機能を説明する。

レーザ発振器 1 から出たレーザ・ビーム2alは凸レンズ3b を通過した後、一旦集光して再び拡がり、凸レンズ35よ りも焦点距離の長い凸レンズ40によって、レーザ・ビー ム2aよりもビーム径が大きく平行なレーザ・ビーム2dと なる。レーザ・ビームZdは凸型円筒レンズ5によって水 平方向が一旦集光しで再び依がり、凸型円筒レンズ5よ ・ビーム?dよりも水平方向が拡大された平行なレーザ・ ビーム2eとなる。レーザ・ビーム2eは、反射ミラー7に よって集光光学装置8に入射し、集光光学装置8内の各 々の平凸レンズ11によりレーザ・ビーム2eが集光され、 多点スポットとして披加工物9に照射される。さらに、 被加工物9は、X-Yデーブル10によって移動され、所 定の加工が施される。

### 発明が解決しようとする課題

一般に、固体レーザ (Nd-YAGレーザ等) や気体レー 面強度分布は、一様ではなく、第13図(a)に示すよう なガウス分布をしている。また、例えば第12図で示した レーザ加工装置のように、発振器1から出たレーザ・ビ ー2aのビーム径を拡けたり、ビームの断面形状を変形さ せても、レーザ・ビーム2eの断面強度分布は、钼変わら ずガウス分布をしている。つまり、第12図(8)に示す ように、レーザ・ビーム2eの中心で強度が最も強く、周 辺に遠ざかるに従って指数関数的に減少していく。

また、このようなガウス分布をしているレーザ・ビー ム2eを、平凸レンズ11寸構成されている集光光学装置8 50 レーザ加工装置である。

で巣光し、多点スポットとして彼加合物9に照射した 時、各加工点12でのレーザ・エネルギ密度(単位面積当 たりのレーザ・ビーム強度) も、ガウス分布となり、加 工領域の中央部で強く、周辺部で弱くなる。

第12図(り)は、レーザ・ビーム強度に対する加工条 件幅と加工可能領域との関係を表しており、図中の斜線 部分は、有効に加工に使われるレーザ・ビーム2eのエネ ルギ量を表している。逆に、図中の斜線以外の部分は、 有効に使われないエネルギ量を表している。

つまり、レーザ・ビーム2eの断面強度分布が一様では なくガウス分布をしているため、加工可能領域はレーザ ・ビーム強度の加工条件幅により制限を受け、レーザ・ ビームZeの全エネルギを有効に加工に利用することがで きないという課題を有していた。

例えば、連続発振YACレーザをQスイッチでパルス化 して、A7膜1000Aの蒸着フィルムに照射し、フィルムに 損傷を与えることなく、フィルム上のAI膜だけを除去す るという加工を考える。第12図で示したようなレーザ加 工装置を用いて上記の加工を行った場合、レーザ・エネ 2dの断面形状を変形させるための凸型円筒レンズ、8 は 20 ルギ密度が2×10 J/cm 以上になるとフィルムに損傷が 入り、1.6×10' J/cm'以下では、蒸着フィルム上のAI膜 が除去されなかった。つまり、レーザ・エネルギ密度の 加工条件幅が1.6×10'~2×10' J/cm と非常に狭いた め、加工可能領域も小さくなり、また、レーザ・ビーム の全エネルギに対して、約3割程度しか有効に利用して いないことが判明した。

そこで本発明はこの課題を解決するため、集光光学装 置8内の各集光レンズ11に入射するレーザのエネルギ量 を等しくし、さらに各加工点12でのレーザ・エネルギ密 りも焦点距離の長い凸型円筒レンズ6によって、レーザ 30 度を等しくするレーザ加工装置を提供するものである。 課題を解決するための手段

上記課題を解決するための本発明の1の発明は、レー ザ発振器と、このレーザ発振器から出たレーザ・ビーム の断面強度を均一にすべく、中央部ではレーザ・ビーム を拡げ、かつ周辺部ではレーザ・ビームを拡げない形状 とした非球面を有する第1の非球面レンズと、前記第1 の非球面レンズにより断面強度を均一化されたレーザ・ ピームを平行ビームに戻す形状とした非球面を有する第 2の非球面レンズと、前記第2の非球面レンズを通過し ザ(CQ レーザ等)か引発振されるレーザ・ビームの断 40 たレーザ・ビームの光路内に平面上に 1 列もしくは複数 列に集光レンズを配置して構成した集光光学装置とを備 えたレーザ加工装置である。

> 本発明の第2の発明は、レーザ発振器と、このレーザ 発振器から出たレーザ・ビームの光路内に平面上に1列 もしくは複数列に配置された複数の集光レンズからな り、かつ前記複数の集光レンズにおいて、各々の集光レ ンズに入射するレーザ・ビームのエネルギ量を等しくす べく、中央部に位置するものより周辺部に位置するもの。 がレンズ径が大きくなるよう構成したことを特徴とする

作用

本発明の第1の発明によれば、非球面レンズを用いることにより、ガウス分布をしているレーザ・ビームの断面強度分布な均一分布となり、その均一化されたレーザ・ビームはいくつかの集光レンズで構成される景光光学装置に照射される。各々の景光レンズに入射するレーザ・ビームの強度は均一であるため、景光レンズで崇光された各加工点でのレーザ・エネルギ密度も等しくなる。そのため、加工領域の中央部でも周辺部でも均一に加工することができる。さらに、レーザ・ビームのエネルギ 10の大部分を有効に加工に利用できるようになるため、加工可能領域を拡げることができる。

また、本発明の第2の発明によれば、集光光学装置内の 気光レンズの形状(レンズ経)を中央部に位置するもの のより周辺部に位置するものがレンズ径が大きくなるよう 特成することにより、各々の集光レンズに入射するレ ーザ・ビームのエネルギ量を等しくすることができる。 実施例

本発明の実施例について以下図面を参照しながら説明する。

第1図は本発明の第1の発明の一実施例におけるレーザ加工装置の構成図である。同図において、1はレーザ発振器 1から出たレーザ・ビーム、3と4はレーザ・ビーム2aの断面強度分布を均一分布にするための非球面レンズ、5と6はレーザ・ビーム2bの断面形状を変化させるための凸型円筒レンズ、7は全反射ミラー、8は紫光光学装置、9は被加工物、10はX-Yテーブル、11は代表的な紫光レンズである平凸レンズである。

以上のように常成されたレーザ加工装置について、そ 30 る。の機能を説明する。レーザ発振器 1 から出たレーザ・ビーム 2aの 平行性を保らつつ、かつ、その断面強度がガウス分布から均一分布へ変換される。均一化されたレーザ・ビーム 2bは、凸型円筒レンズ 5 によって水平方向が一旦業光して拡がり、凸型円筒レンズ 5 よりも魚点距離の長い凸型 円筒レンズ 6 によってレーザ・ビーム 2cとなる。レーザ・ビーム 7 によって第光光学装置 8 に入 財し、集光光学装置 8 内の各々の平凸レンズ 11によりレ 40 一代・ビーム 2cが集光され、多点スポットとして被加工 物9 に照射される。さらに、被加工物9 は、X - Yテーブル10によって移動され、所定の加工が施される。 用し

次に、レーザ・ビーム2aの断面強度分布をガウス分布 たレーザ・ビーム2aは凸レンズ3 4の機能につい 光して再び拡がり、凸レンズ3 て定性的に説明する。第2図は、第1図のレーザ加工装 レンズ4nによって、レーザ・と 量における非球面レンズ3,4光学系の拡大図であり、ビ イ平行なレーザ・ビーム2dとな はならないことは、レーザ・と ズ3の非球面部において、ビーム強度の強い中央部では 第1の実施例のように均一分額 ビームを拡げ、逆にビーム強度の弱い周辺部ではビーム 50 ウス分布をしている点である。

を拡げないようにして、ビーム強度を均一にする。一方、非球面レンズ4の非球面部において、拡げられた各ビームを元の平行ビームに戻す。第3図(a)は、ガウス分布をしているレーザ・ビーム2aの断面AーAのビーム強度、第3図(b)は、均一化されたレーザ・ビーム2bの断面BーBのビーム強度を表している。さらに、この均一化されたレーザ・ビーム2bを、栄光光学装置8内の平凸レンズ11で集光し、多点スポットとして被加工物9に照射すると、その加工点12でのエネルギ密度はすべて等しくなる。

また、第4図は、レーザ・ビーム強度に対する加工条件幅と加工可能領域との関係を表わしており、(a)は従来のレーザ加工装置の場合であり。(b)は本実施例におけるレーザ加工装置の場合である。図中の斜線部分は有効に加工に利用できるレーザ・ビームのエネルギ量を表わしている。

以上のように本実施例によれば、非球面レンズ3,4を用いてレーザ・ビーム2aの断面強度分布を均一分布にし、平凸レンズ11で集光し、多点スポットとして被加工20 物9上に照射することにより、各加工点12でのレーザ・エネルギ密度が等しくなり、中央部でも周辺部でも均一に加工することができる。さらに、レーザ・ビームのエネルギの大部分を有効に加工に利用できるようになり、加工可能領域を拡げることができる。

第5図は本発明の第1の発明と同様の効果を狙ったレーザ加工装置(参考例)の構成図である。同図において、第1図と同一物には同一番号を付し説明を省略する。同図において、第1図と異なる点は、非球面レンズ3,4の代わりに、非球面ミラー3a、4aを用いている点である

このレーザ加工装置の機能は、第1の実施例の場合とほぼ同じであり、異なっている点は、ガウス分布をしているレーザ・ビーム2aの断面強度分布を均一分布に変換する手段が、非球面レンズ3,4から非球面ミラーに代わっている点だけである。

従って、この参考例においても、前述の実施例と同様 の効果が得られる。

第6図は本発明の第2の発明の一実施例におけるレーザ加工装置の構成図である。同図において、第1図と同一物には同一番号を付し説明を省略する。同図において、第1図の構成と異なる点は2つあり、その一つは、非球面レンズ3,4を使用せず、球面の凸レンズ3b,4もを使用している点である。そのため、レーザ発振器1から出たレーザ・ビーム2aは凸レンズ3bよりも焦点距離の長い凸レンズ4bによって、レーザ・ビーム2dとなる。ことで注意しなければならないことは、レーザ・ビーム2dの断面強度分布が第1の実施例のように均一分布ではなく、依然としてガウス分布をしている点である。

図は第2の実施例における某光光学装置8aの拡大図であ り、6個の平凸レン水11aで構成されており、ビームの 強度分布は光線密度で表わされている。

次に、この集光光学装置8aの機能を第7図を参照しな がら説明する。まず』集光光学装置8aに入射するレーザ ・ビーム2eの断面強度分布は均一分布ではなく、ガウス 分布となっている。そのため、集光光学装置84内の6個 の平凸レンズ11aの形状は、レーザ・ビーム2eのビーム 強度分布に合わせて変えている。つまり、具体的には、 各々の平凸レンズ11なC入射するレーザ・ビーム2eのエ ネルギ量が等しくなるように、その平凸レンズ11aの大 きさ (断面積) を変えている。ガウス分布は中央部で強 度が強く、周辺へ逸さかるに従って弱くなるため、集光 光学装置8a内の平凸以ンズ11aの大きさは、中央部では 小さく、逆に、周辺部では大きくなる。さらに、第7図 の1点鎖線で示すように、各々の平凸レンズ11aの光軸 と加工点12とを合わせているため、レーザ・ビーム2elは 各々の平凸レンズ11歳より各々の加工点12に集光され る。

従って、各加工点はでのレーザ・エネルギ密度は等し くなり、中央部でも周辺部でも均一に加工することがで きる。つまり、本実施例においても第1の実施例と同様 の効果が得られる。

第8図は本発明の第2の発明と同様の効果を狙ったレ ーザ加工装置 (参考例) の構成図である。同図におい て、第1図と同一物には同一番号を付し説明を省略す る。同図において、第1図の構成と異なる点は2つあ り、その一つは、非球面レンズ3,4を使用しないで、球 面の凸レンズ36、40を使用している点である。

もう一つの異なる点は、反射ミラー7と集光光学装置 8との間に、レーザ・ビーム2eのエネルギを等しく分割 するビーム分割装置13が配置されている点である。第9 図は6個のプリズム14で構成されているビーム分割装置 13と、6個の平凸レン区11で構成されている集光光学装 置8の拡大図である。同図において、斜線部分は、レー ザ・ビームZeの通過する領域を示している。

次に、このビーム分割装置13の機能を第9図を参照し ながら説明する。まず、ビーム分割装置13に入射するレ る。そのため、ビーム分割装置13内の6個の各々のブリ ズム14の形状は、レーザ・ビーム2eのビーム強度分布に 台わせて変えている。つまり、具体的には、各々のプリ ズム14に入射するレーザ・ビーム2eのエネルギ量が等し くなるように、そのプリズム14の大きさ(断面積)を変

えている。また、各々のプリズム14はレーザ・ビーム2e の光軸に対して傾けて配置されているため、レーザ・ビ ーム2eはプリズム14に入射する時外側へ屈折し、逆に、 プリズム14から出射する時内側へ屈折する。さらに、各 ャのプリズム14を通過したレーザ・ビーム2fが、 集光光 学装置8内の各々の平凸レンズ11に入射するように、各 ャのブリズム14の長さを変えている。

従って、各々の平凸レンズ11に入射するレーザ・エネ ルギの量は等しくなり、各加工点12でのレーザ・エネル 10 ギ密度も等しくなる。

#### 発明の効果

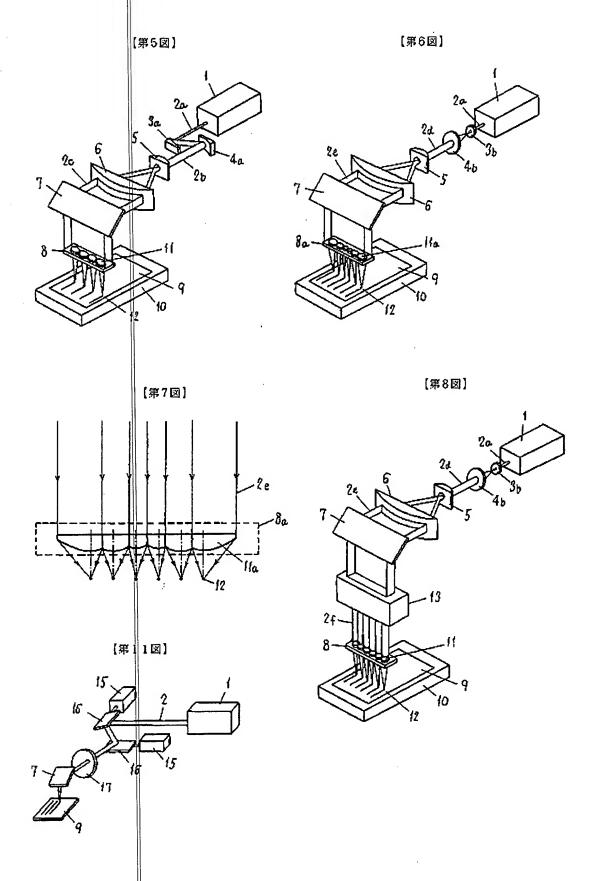
本発明の第1の発明及び第2の発明に対して、集光光 学装置内の各々の集光レンズに入射するレーザ・ビーム のエネルギ量が等しく、集光レンズの光軸に対して垂直 にレーザ・ビームが入射するため、集光レンズで集光さ れた各加工点でのレーザ・エネルギ密度は等しくなる。 そのため、加工領域の中央部でも周辺部でも均一に加工 することができる。 さらに、レーザ・ビームのエネルギ の大部分を有効に加工に利用できるため、加工可能領域 20 を拡げることができる。

### 【図面の簡単な説明】

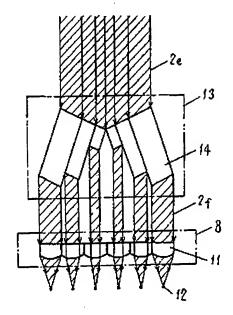
第1図は本発明の第1の発明の一実施例におけるレーザ 加工装置の構成図、第2図は第1図のレーザ加工装置に おける非球面レンズ光学系の拡大図。第3図は非球面レ ンズ光学系通過前後におけるレーザ・ビームの断面強度 分布図、第4図はレーザ・ビーム強度の加工条件幅と加 工可能領域との関係を表わした図、第5図は本発明の第 1の発明と同様の効果を狙ったレーザ加工装置(参考 例)の構成図、第6図は本発明の第2の発明の一実施例 30 におけるレーザ加工装置の構成図、第7図は第6図のレ ーザ加工装置における集光光学装置の拡大図、第8図は 本発明の第2の発明と同様の効果を狙ったレーザ加工装 置(参考例)の構成図、第9図は第8図のレーザ加工装 置におけるビーム分割装置と集光光学装置の拡大図、第 10図は従来のレーザ加工装置のうちX-Yテーブル型の 構成図、第11図は従来のレーザ加工装置のうちガルバノ ・メータ型ビーム走査装置の構成図。第12図は従来の多 点同時加工可能なレーザ加工装置の構成図、第13図は従 来のレーザ加工装置におけるレーザ・ビームの断面強度 ーザ・ビーム2eの断面強度分布はガウス分布となってい 40 分布及びレーザ・ビーム強度の加工条件幅と加工可能領 域との関係を表した図である。

> 1……レーザ発振器、2,2a~2e……レーザ・ビーム、3、 4……非球面レンズ、11,11a,11b……集光レンズ、8,8a ······ 梟光光学装置、3a,4a·····非球面ミラー、13······ビ ーム分割装置。

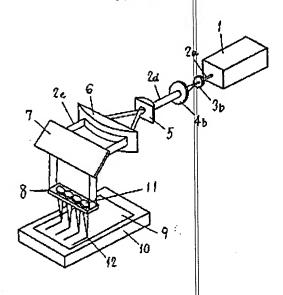
【第1図】 【第2図】 1…しず光振器 3.4…非成器レッズ 8…異先先学装造 11…集光レンで 【第4図】 【第3図】 ピム発度 (2) (4) (b) ピム独友 ピーム強度 邓工可恢顿或 【第10図】 とム強度 (b) 一四工可能领域一



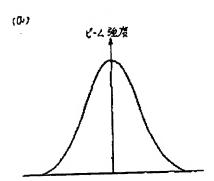
【第9図】

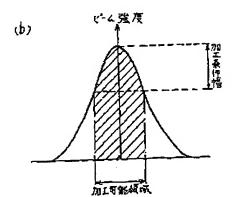


【第12図】



【第13図】





## フロントページの続き

(56)参考文献 特開 昭63-108318 (JP, A)

特開 昭60-191689 (JP, A)

実開 昭62-105780 (JP, U)

実開 昭56-50583 (JP. U)